PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 05154422 A

(43) Date of publication of application: 22.06.83

(51) Int. Cl B05B 15/00

(21) Application number: 03320292 (71) Applicant: FUJITSU LTD

(22) Date of filing: 04.12.91 (72) Inventor: TOKUMARU YUICHI

(54) GAS EJECTION DEVICE AND COLLIMATION METHOD OF THE SAME

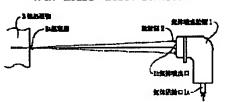
(57) Abstract:

PURPOSE: To provide the gas ejection device which can exactly blow the high- pressure gas ejected from the gas ejection port of the gas ejection device to the part to be worked of the material to be worked.

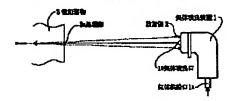
CONSTITUTION: The gas ejection device 1 having a gas supply port 1a for supplying the high-pressure gas and the gas ejection port 1b for ejecting the high- pressure gas is constituted by having laser beam radiation parts 2 for radiating laser beams in the direction where the has ejected from the gas ejection port 1b is ejected on both sides of the gas ejection port 1b.

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japlo

O) 無利が他を理論ないのの要素をいたる。た場合を収す機



(1) 記念が発売運動(2) の知識を含むからてれた場合を挙す業



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-154422

(43)公開日 平成5年(1993)6月22日

(51)Int.CL⁸
B 0 5 B 15/00

織別配号

FΙ

技術表示箇所

庁内整理番号

7726-4D

審査請求 未請求 請求項の数2(全 4 頁)

*			
(21)出顯番号	特願平3-320292	(71)出願人	000005223 富士通妹式会社
(22)出顧日	平成3年(1991)12月4日		神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
		(72)発明者	徳丸 裕一 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
		(74)代理人	弁理士 井桁 貞一

(54)【発明の名称】 気体噴出装置及びその照準方法

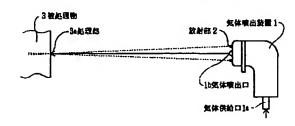
(57)【要約】

【目的】 気体噴出装置の改良及びその照準方法の改善に関し、気体噴出装置の気体噴出口から噴出する高圧気体を、被処理物の処理部に正確に吹き付けることが可能となる気体噴出装置及びその照準方法の提供を目的とする。

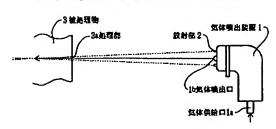
【構成】 商圧気体を供給する気体供給口1aと、この商 圧気体を噴出する気体噴出口1bとを備えた気体噴出装置 1 において、この気体噴出口1bから噴出する気体が噴出 する方向にレーザビームを放射するレーザビームの放射 部2を、この気体噴出口1bの両側に具備するように構成 する。

本発明による一実施例の気体吸出装置の照準方法を説明する図

(a) 照準が被処理物(3) の処理部(3a)に合った場合を示す図



(b) 脳準が被処理物(3) の処理部(3a)からずれた場合を示す図



【特許請求の範囲】

【請求項1】 高圧気体を供給する気体供給口(1a)と、 前記高圧気体を噴出する気体噴出口(1b)とを備えた気体 噴出装置(1) において、

前記気体噴出口(1b)から噴出する気体が噴出する方向に レーザビームを放射するレーザビームの放射部(2)を、 前記気体噴出口(1b)の両側に具備することを特徴とする 気体噴出装置。

【請求項2】 請求項1記載の気体噴出装置の照準方法 であって、

前記気体噴出口(1b)から噴出される気体を吹き付ける被 処理物(3) に相当する位置に、前記放射部(2) から放射 された前記レーザビームが一致して照射されるように前 記放射部(2) の方向を固定し、前記気体噴出装置(1) の 前記気体噴出口(1b)を被処理物(3)の方向に向ける工程

前記被処理物(3) の処理部(3a)に、前記2本のレーザビ ームが一致して照射される位置に前記気体噴出装置(1) を固定し、前記気体噴出口(1b)から前記高圧気体を噴出 させる工程と、

を含むことを特徴とする気体噴出装置の照準方法。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、気体噴出装置の改良及 びその照準方法の改善に関するものである。近年の半導 体装置の製造工程においては、半導体基板上の局部的な 小さな領域の処理部に高圧気体を吹き付けてこの領域内 の異物のみを除去し、その周囲の領域には髙圧気体を吹 き付けないようにすることが必要である。

【0002】以上のような状況から、被処理物の処理部 30 のみに高圧気体を吹き付けることが可能な気体噴出装置 及びその照準方法が要望されている。

[0003]

【従来の技術】従来の気体噴出装置及びその照準方法を 図3により詳細に説明する。図3は従来の気体噴出装置 を示す図であり、気体噴出口16から被処理物の処理部に 吹き付けられる高圧気体は気体供給口1aから供給されて

【0004】とのような気体噴出装置1を用いて高圧気 体を被処理物の処理部に吹き付ける場合には、この気体 40 噴出装置 1 を使用する作業者の感覚により距離及び方向 を定めて、高圧気体を被処理物の処理部に吹き付けてい

【0005】とのため高圧気体を所望の位置に正確に吹 き付けることが困難であり、所定の処理部の位置の周辺 部にも高圧気体が吹き付けられる場合がある。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】以上説明した従来の気 体噴出装置及びその照準方法においては、作業者の感覚 により距離及び方向を定めているため、気体噴出装置と 50 体を被処理物3の処理部3aに吹き付ける場合に、図2

被処理物との間隔及び高圧気体が噴出する方向が不正確

になり、高圧気体が所望の処理部以外の部分に吹き付け られる場合があり、商圧気体に異物が含まれている場合 には処理部以外の部分が汚染されるという問題点があっ

【0007】本発明は以上のような状況から、気体噴出 装置の気体噴出口から噴出する商圧気体を、被処理物の 処理部に正確に吹き付けることが可能となる気体噴出装 置及びその照準方法の提供を目的としたものである。

10 [0008]

【課題を解決するための手段】本発明の気体噴出装置 は、商圧気体を供給する気体供給口と、この商圧気体を 噴出する気体噴出口とを備えた気体噴出装置において、 との気体噴出口から噴出する気体が噴出する方向にレー ザビームを放射するレーザビームの放射部を、この気体 噴出口の両側に具備するように構成する。

【0009】本発明の気体噴出装置の照準方法は、上記 の気体噴出装置の照準方法であって、この気体噴出口か ら噴出される気体を吹き付ける被処理物に相当する位置 20 に、2本のこのレーザビームが一致して照射されるよう にこの放射部の方向を固定し、この気体噴出装置のこの 気体噴出口を被処理物の方向に向ける工程と、この被処 理物の処理部に、との被処理物の処理部に、との2本の レーザビームが一致して照射される位置にこの気体噴出 装置を固定し、この気体噴出口からこの高圧気体を噴出 させる工程とを含むように構成する。

[0010]

【作用】即ち本発明においては、所望の位置において交 差する2本のレーザビームを放射するレーザビームの放 射部を気体噴出装置の気体噴出口の両側に設けているか ら、被処理物の処理部にとの2本のレーザビームが一致 して照射される位置にこの気体噴出装置を固定して高圧 気体を吹き付けると、被処理物の処理部にのみ正確に高 圧気体を吹き付けることが可能となる。

[0011]

【実施例】以下図1~図2により本発明の一実施例につ いて詳細に説明する。図1は本発明による一実施例の気 体噴出装置を示す図、図2は本発明による一実施例の気 体噴出装置の照準方法を説明する図である。

【0012】図1に示すように、気体噴出装置の気体噴 出口1bから被処理物の処理部に吹き付けられる高圧気体 は気体供給口1aから供給されており、この気体噴出口1b の両側の2箇所にはレーザビームの放射部2が設けられ ている。

【0013】 このレーザビームの放射部2は図2(a) に 示すように、この放射部2から放射されるレーザビーム が気体噴出口1bと被処理物3との最適距離において一致 するように調節されて固定されている。

【0014】このような気体噴出装置1を用いて商圧気

3

(b) に示すように被処理物3の処理部3aと気体噴出装置 1の気体噴出口1bとの距離が最適距離と異なる場合に は、この2本のレーザビームが2個所に照射され、距離 が不適当であることがわかる。

【0015】この距離を最適距離にし、被処理物3の処理部3aにこの2本のレーザビームが一致して照射される位置にこの気体噴出装置1を固定して高圧気体を吹き付けると、図2(a)に示すように被処理物3の処理部3aにのみ正確に高圧気体を吹き付けることが可能となる。

[0016]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明によれば極めて簡単な構造の変更により、気体噴出口と被処理物の処理部との距離を最適にした状態で高圧気体を吹き付けることが可能となる利点があり、著しい経済的及び、信頼性向上の効果が期待できる気体噴出装置及*

*びその照準方法の提供が可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明による一実施例の気体噴出装置を示す図、

【図2】 本発明による一実施例の気体噴出装置の照準 方法を説明する図、

【図3】 従来の気体噴出装置を示す図、

【符号の説明】

1は気体噴出装置、

10 1aは気体供給口、

16は気体噴出口、

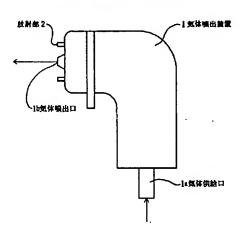
2は放射部、

3は被処理物、

3aは処理部、

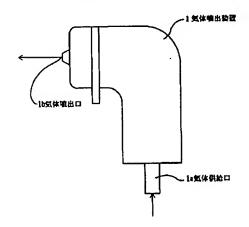
[図1]

本発明による一実施例の気体験出装置を示す図



【図3】

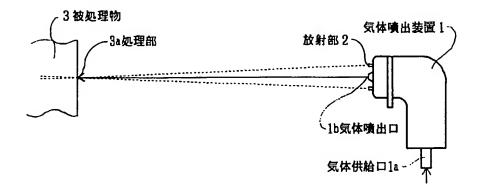
従来の気体験出装置を示す図



【図2】

本発明による一実施例の気体噴出装置の照準方法を説明する図

(a) 照準が被処理物(3) の処理部(3a)に合った場合を示す図



(b) 照準が被処理物(3) の処理部(3a)からずれた場合を示す図

